

**S&S** TECH

***“The World Best Blank Mask”  
Global Leader***

**(주)에스앤에스텍**

**2015. 11**

본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 일부 표현될 수 있습니다.

이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관련된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다.

'예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

- 환율, 이자율 등의 변동을 포함한 국내외 금융 시장의 동향
- 사업의 처분, 매수 등을 포함한 회사의 전략적인 의사결정
- 회사가 영위하는 주요 사업 환경의 예상치 못한 급격한 여건변화
- 기타 본 사업과 관련된 시장의 여건 변화
- 기타 경영현황 및 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 국내/외적 변화

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 '예측정보'에 명시적 또는 묵시적으로 포함한 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

# 내 용

## I. 회사 소개

회사 개요

회사 연혁( 인증 및 수상 )

## II. 제품 소개

블랭크마스크 정의 / 역할 / 사진  
공급체인

## III. 일반 현황

기술개발 개요  
경영실적

# 회사 소개

## ■ 회사 개요

- 법인설립 : 2001. 02. 22 (주) 에스앤에스텍
- 대표이사 : 남 기수
- 생산제품 : 반도체 및 FPD 용 블랭크마스크  
(반도체용 - 6 인치, Display용 - 33x45 cm ~ 122x140 cm)
- 경영실적 : 매출액 - 2014년 457억 원 , 영업이익 - 67억 원
- 주요고객 : SEC, SK Hynix, TSMC, PKL, Toppan, Photronics, SMIC 등
- 소재지 : 대구 달서구 성서첨단산업단지
- 자본금 : 80 억 원 ( 2014.12.31일 기준 )
- 총인원 : 175명
- 특허보유 : 특허출원 246건 { 등록 101건 - 국내 76건, 해외 25건 }

# 회사 소개

## ■ 회사 연혁 : 인증

## “The World Best Blank Mask” Global Leader

## ■ 회사 연혁 : 수상

- 2014.05 World Class300 선정
- 2013.07 대구월드스타기업 선정
  - 2011.04 히든챔피언 선정
- 2010.10 히든챔피언 선정
- 2010.07 부품소재전문기업 재인증
- 2009.08 히든챔피언 선정

- 2008.12 대한민국 10대 신기술 지정
- 2008.08 우수제조기술 연구센터(ATC) 지정



- 2005.06 신제품 인증 (NEP 인증)
- 2005.06 세계일류상품 선정(차세대)
- 2004.08 기술 혁신형 중소기업(INNO-BIZ)인증
- 2004.06 하이닉스 품질인증
- 2004.06 Toppan 품질인증
- 2004.03 부품소재 전문기업 인증
- 2003.09 Photronics Global 품질인증
- 2003.05 삼성전자 품질인증
- 2001.10 ISO 9001 인증
- 2001.10 PKL 품질인증

- 2001 ~ 2002
  - 2001.02 에스앤에스텍 설립

● 2014  
~  
2011

● 2010

● 2009

● 2007  
~  
2008

● 2005 ~ 2006

● 2003 ~ 2004

- 2013.09 전자/IT/반도체/디스플레이산업 발전 유공 대통령표창 (남 기수 대표이사)
- 2012.01 삼성전자 “신기술공모제” 선정
- 2010.11 “2,000만불 수출의 탑” 수상
- 2009.12 현재일류 상품 선정
- 2009.12 지역전략산업진흥사업 지식경제부 장관상 수상
- 2009.04 코스닥 상장
- 2008.12 부품소재상 지식경제부 장관상 수상  
대한민국기술대상 은상 수상
- 2008.11 ‘1,000 만불’ 수출의 탑 수상
- 2008.10 ‘2008년 벤처기업 대상’ 국무총리상 수상
- 2008.06 코스닥 상장 예비심사 승인
- 2007.03 대구광역시 스타기업 선정
- 2005.11 ‘500만불’ 수출의 탑 및 산업부 장관 표창 수상
- 2005.08 제6회 중소기업 기술혁신 대전 “대통령상” 수상

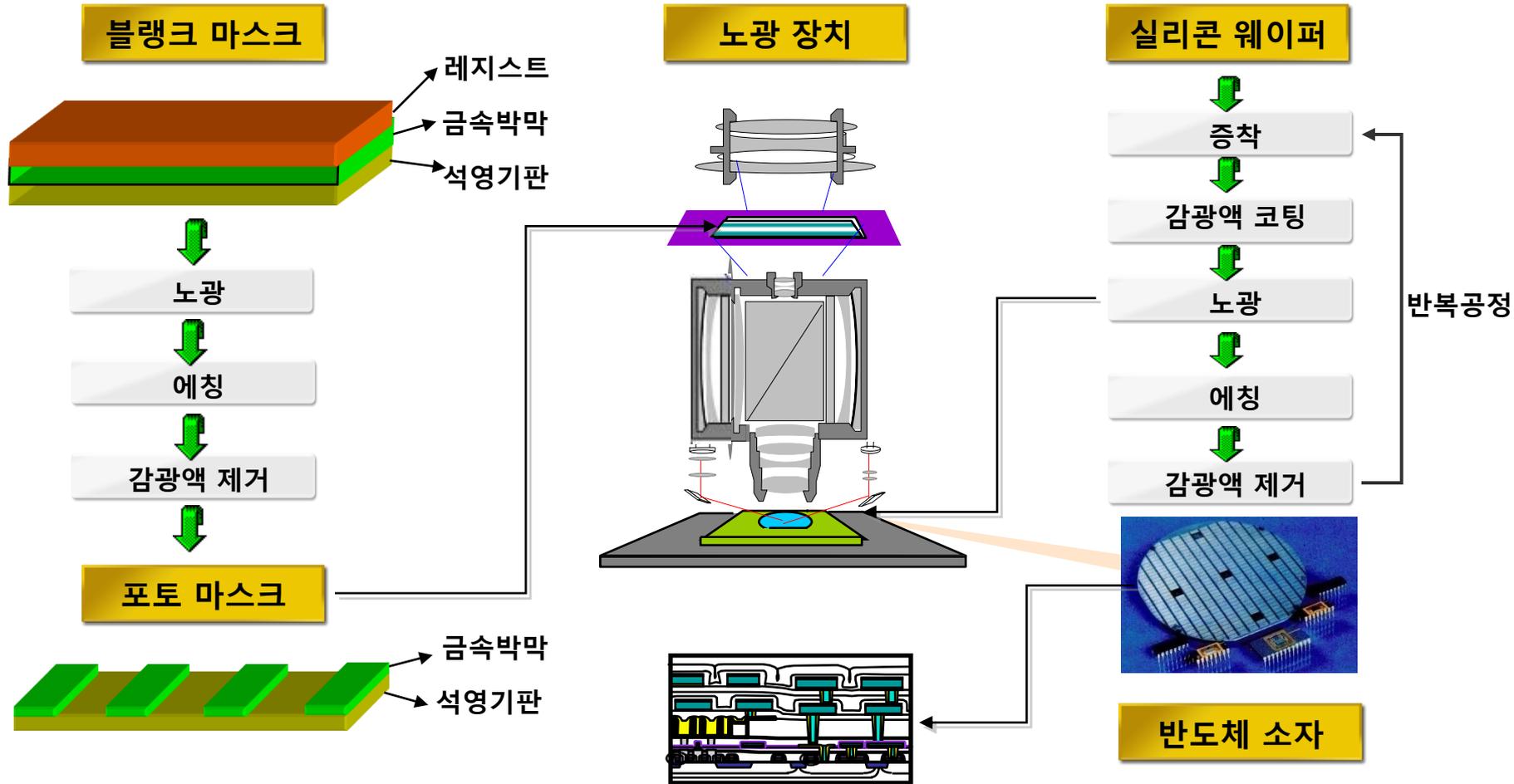


# 블랭크 마스크 정의

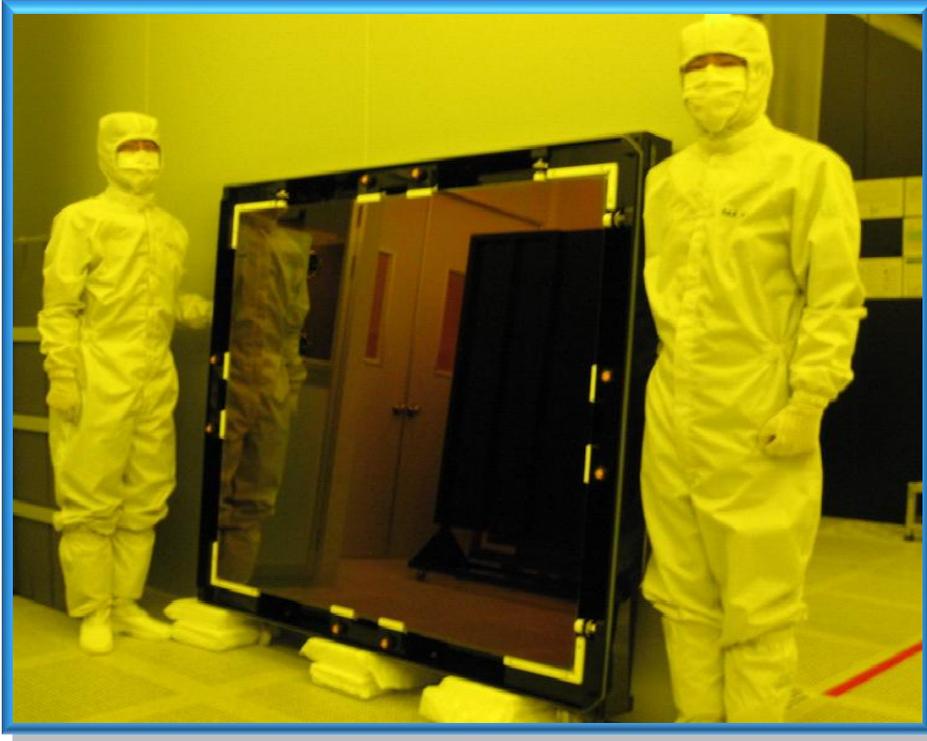
- \* 반도체 및 FPD (TFT-LCD, Color Filter, OLED, LED) 제조공정에 필수적인 포토마스크의 핵심원재료
  - 블랭크마스크는 석영유리기판 위에 차광막, 반사방지막, 감광막으로 구성
- \* 100% 전량 일본으로부터 수입되던 블랭크 마스크를 당사에서 2002년도에 국산화에 성공함



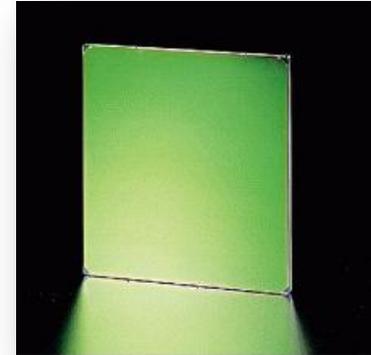
# 블랭크 마스크의 역할



# 제품 사진

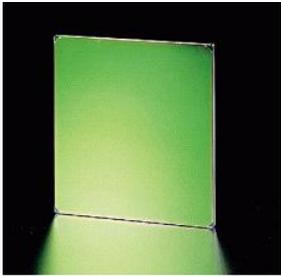
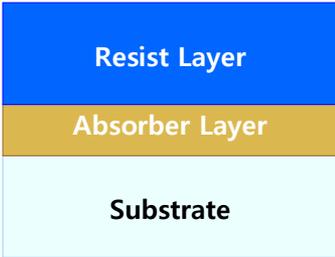
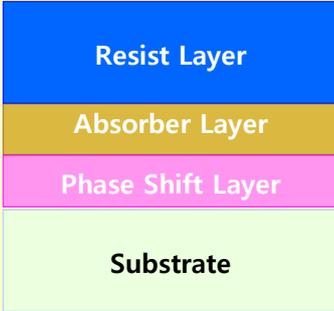
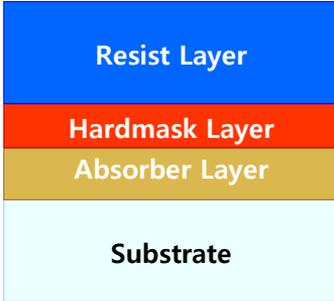
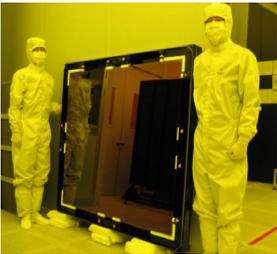
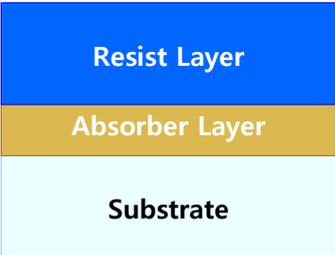
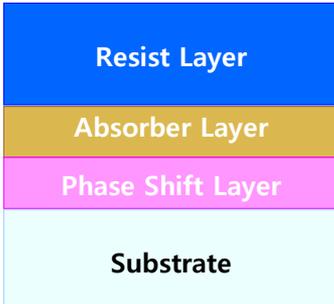


평판디스플레이용(FPD) 대형 블랭크 마스크



반도체용 블랭크 마스크

# 제품 소개

구 분	제품사진	주요제품		
		바이너리 블랭크 마스크 (Binary Blank Mask)	위상시프트 블랭크 마스크 (Phase Shift Blank Mask)	하드마스크용 블랭크 마스크 (Hardmask Blank Mask)
반도체용 (IC용)				
구 분	제품사진	바이너리 블랭크 마스크 (Binary Blank Mask)	그레이톤 블랭크 마스크 (Gray-tone Blank Mask)	위상시프트 블랭크 마스크 (Phase shift Blank Mask)
평판 디스플레이용 (FPD용)				

# 공급 체인

## 반도체용 마스크

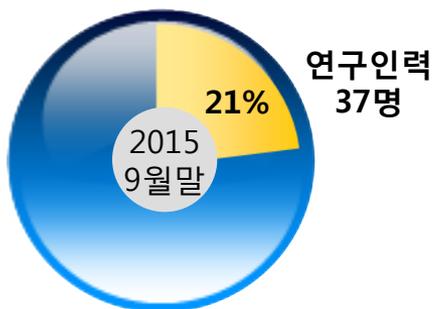
## FPD용 마스크

	반도체용		FPD용
End User	삼성, 하이닉스, TSMC SMIC, Intel, IBM...	적용 제품 반도체 IC, TFT Array Color Filter, OLED	삼성, LG-Display AUO, CMO, CFI, .....
Photo Mask	Toppan, Photronics, DNP PKL, 삼성, 하이닉스, TSMC TMC, SMIC...	패턴형성 * Captive shop * Merchant shop	PKL, HOYA PKLT, Supermask DNP, Toppan, Finex
Blank Mask	Hoya, Ulcoat, ShinEtsu <b>S&amp;S TECH</b>	박막형성 (위상변위막, 차광막, 반사방지막, 감광층 등)	Ulcoat, CST <b>S&amp;S TECH</b>
Quartz	ShinEtsu, Tosoh Covalent, Asahi	원재료 (합성석영유리기판)	ShinEtsu, Tosoh, Covalent Nikon, KTG (Korea)

# 기술개발 개요

( 별도 기준 )

## 연구인력 비중



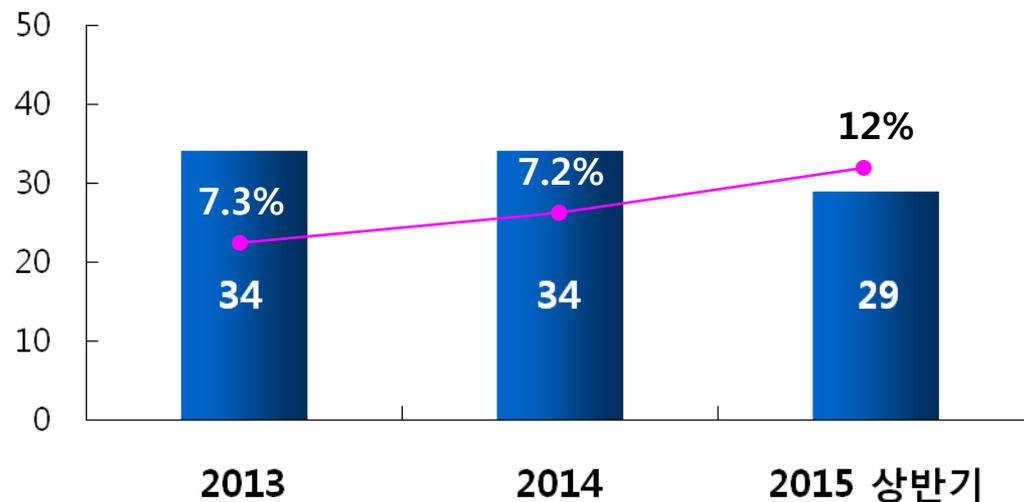
## 특허 보유현황

2015년 9월말 현재

구분	출원	( 등록 )
국내	181	( 76 )
해외	65	( 25 )
<b>총계</b>	<b>246</b>	<b>( 101 )</b>

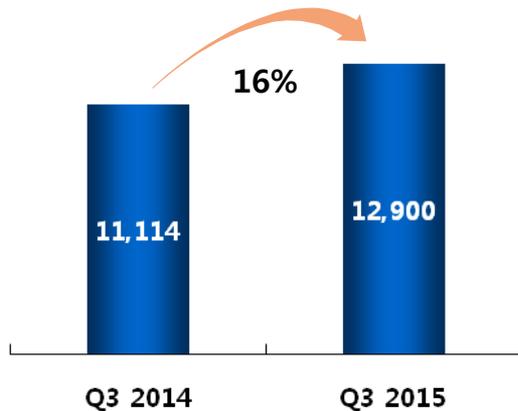
## R&D 투자

( 억원 )

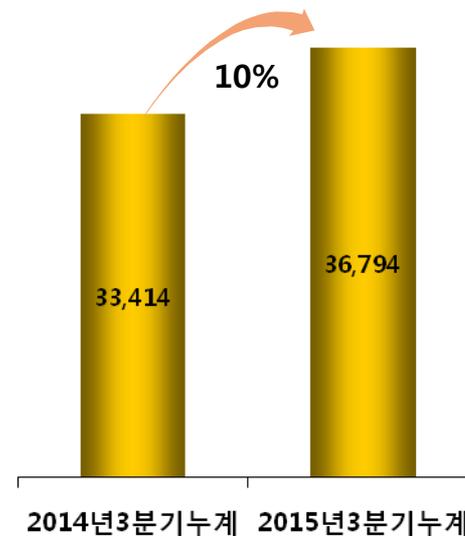


# 2015년 3분기 실적 : 별도 기준

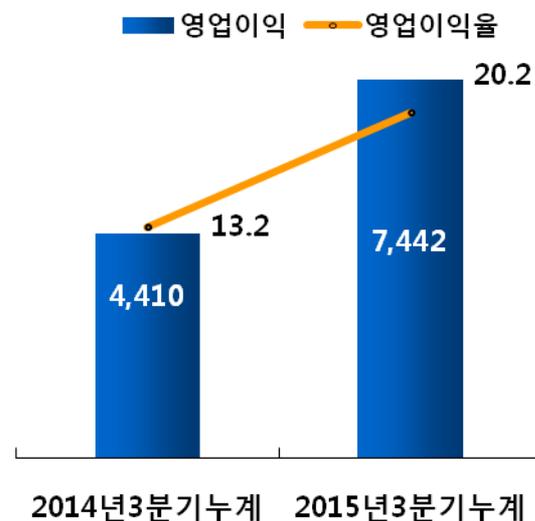
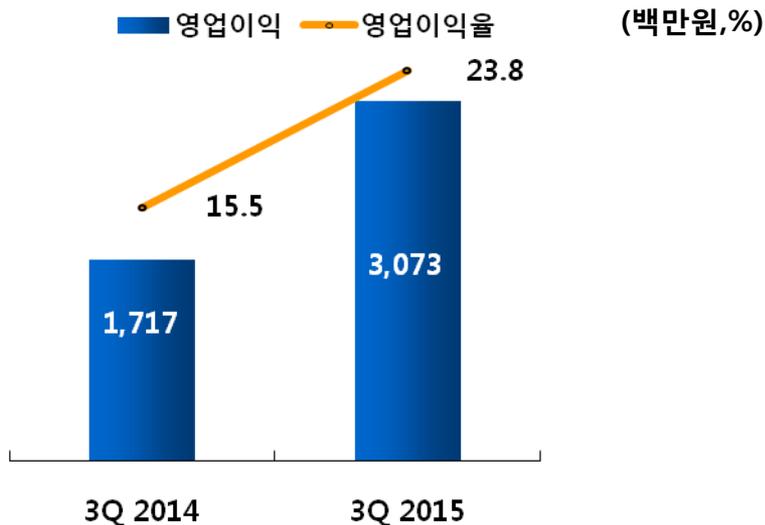
\* 성장성



(백만원)



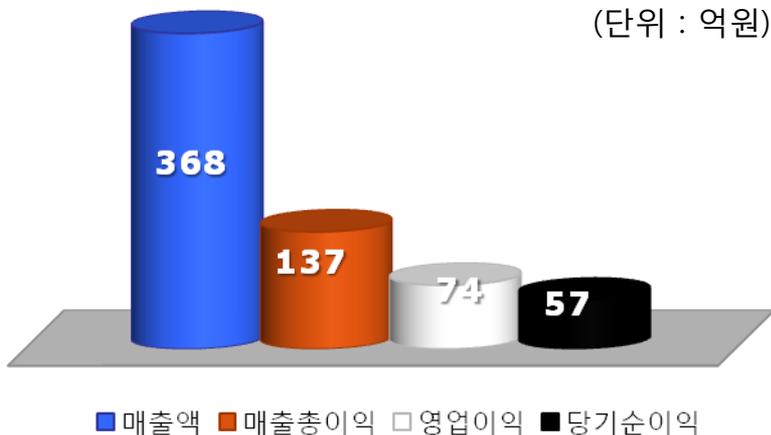
\* 수익성



# 2015년 상반기 재무현황 요약

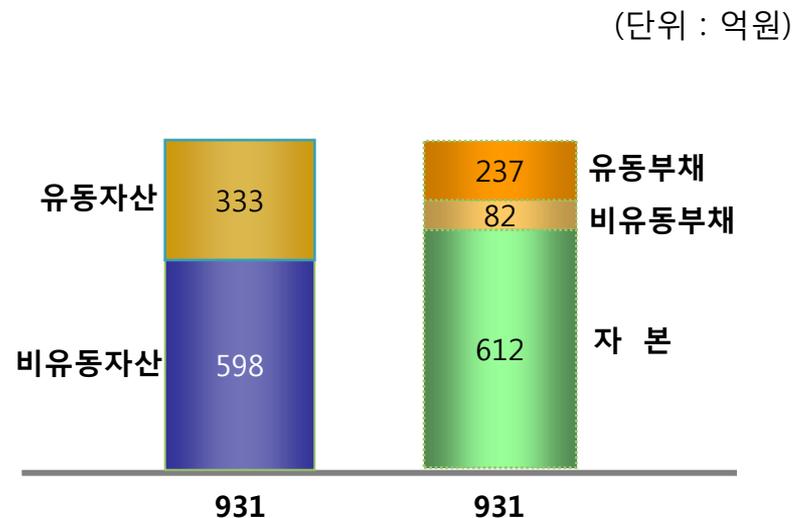
\* 별도 재무제표 기준

## 손익



구분	2015년 3분기	
매출액	368	100.0%
매출총이익	137	37.1%
영업이익	74	20.2%
당기순이익	57	15.5%
차입금의존도	24.6%	

## 재무상태표



구분	2015년 3분기	
자산	931	100%
부채	319	34%
자본	612	66%
부채비율	52%	
유동비율	140%	

# 감사합니다

